

488696-2026 - Konkurss

Īrija – Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Piegādes

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Education Procurement Service (EPS)

E-pasts: info@educationprocurementservice.ie

Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Apraksts: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Procedūras identifikators: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): South-East (IE052)

Valsts: Īrija

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

2.1.5. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Maksimālais daļu skaits, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumus: 4

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Apraksts: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Iekšējais identifikators: 1

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): South-East (IE052)

Valsts: Īrija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: angļu valoda

Valodas, kurās neoficiāli pieejami iepirkuma dokumenti (vai to daļas): angļu valoda

Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: angļu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 180 Dienas

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Vēl nav zināms

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmiens

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: The High Court of Ireland

Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem:

Education Procurement Service (EPS)

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: The High Court of Ireland

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Education Procurement Service (EPS)

Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Daļa: LOT-0002

Nosaukums: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Apraksts: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Iekšējais identifikators: 2

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): South-East (IE052)

Valsts: Īrija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: angļu valoda

Valodas, kurās neoficiāli pieejami iepirkuma dokumenti (vai to daļas): angļu valoda

Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: angļu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 180 Dienas

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Vēl nav zināms

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: The High Court of Ireland

Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem:

Education Procurement Service (EPS)

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: The High Court of Ireland

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Education Procurement Service (EPS)

Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Daļa: LOT-0003

Nosaukums: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Apraksts: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Iekšējais identifikators: 3

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): South-East (IE052)

Valsts: Īrija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: angļu valoda

Valodas, kurās neoficiāli pieejami iepirkuma dokumenti (vai to daļas): angļu valoda

Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: angļu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 180 Dienas

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Vēl nav zināms

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: The High Court of Ireland

Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem:

Education Procurement Service (EPS)

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: The High Court of Ireland

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Education Procurement Service (EPS)

5.1. **Daļa: LOT-0004**

Nosaukums: Plasma Deposition ,PECVD

Apraksts: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Iekšējais identifikators: 4

5.1.1. **Mērķis**

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

5.1.2. **Izpildes vieta**

Valsts apakšiedalījums (NUTS): South-East (IE052)

Valsts: Īrija

5.1.3. **Paredzamais ilgums**

Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.5. **Vērtība**

Paredzamā vērtība bez PVN: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. **Vispārīga informācija**

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. **Stratēģiskais iepirkums**

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. **Atlases kritēriji**

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: angļu valoda

Valodas, kurās neoficiāli pieejami iepirkuma dokumenti (vai to daļas): angļu valoda

Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: angļu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 180 Dienas

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Vieta: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Vēl nav zināms

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamat nolīgums:

Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: The High Court of Ireland

Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem: Education Procurement Service (EPS)

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: The High Court of Ireland

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Education Procurement Service (EPS)

Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Education Procurement Service (EPS)

Reģistrācijas numurs: IE 6609370 G

Pasta adrese: Castletroy Limerick
Pilsēta: Limerick
Pasta indekss: V94 DK53
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Mid-West (IE051)
Valsts: Īrija
E-pasts: info@educationprocurementservice.ie
Tālrunis: 000
Interneta adrese: <https://www.educationprocurementservice.ie/>
Pircēja profils: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Šis organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: The High Court of Ireland

Reģistrācijas numurs: The High Court of Ireland

Departaments: The High Court of Ireland

Pasta adrese: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Pilsēta: Dublin

Pasta indekss: D07 WDX8

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Dublin (IE061)

Valsts: Īrija

E-pasts: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Tālrunis: +353 1 8886000

Šis organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: European Dynamics S.A.

Reģistrācijas numurs: 002024901000

Departaments: European Dynamics S.A.

Pilsēta: Athens

Pasta indekss: 15125

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Valsts: Grieķija

E-pasts: eproc-esender@eurodyn.com

Tālrunis: +30 2108094500

Šis organizācijas lomas:

TED eSender

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Galvenais izmaiņu iemesls

:

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks,
Rietumeiropas vasaras laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: angļu valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 488696-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 134/2026

Publicēšanas datums: 15/07/2026